

セッション一覧表

平成 23 年 11 月 26 日(土)～27 日(日)鹿児島大学 工学部

26 日(土)	A 会場 (201,166 名)	B 会場 (202,108 名)	C 会場 (301,108 名)	D 会場 (302,108 名)	E 会場 (111,110 名)	F 会場 (121,110 名)
9:00-10:24 AM 前半 I (6 件)	薄膜・表面 [a-1～a-6] 古川昌司 九工大情	半導体 B [a-1～a-6] 川島健児 九工大工	半導体 A [a-1～a-6] 佐道泰造 九大シ情	スピン・マグネ [a-1～a-6] 重田 出 鹿大理工	プラズマ [a-1～a-6] 福澤 剛 北九州高専	応用物理一般 [a-1～a-6] 森 保仁 佐世保高専
10:24-10:36	休憩					
10:36-12:00 AM 後半 II (6 件)	薄膜・表面 [a-7～a-12] 福山敦彦 宮崎大工	半導体 B [a-7～a-12] 佐竹昭泰 九工大工	半導体 A [a-7～a-12] 西岡賢祐 宮崎大工	応用物性 [a-7～a-12] 久保田弘 熊大自然	プラズマ [a-7～a-12] 福澤 剛 北九州高専	応用物理一般 [a-7～a-12] 川崎仁晴 佐世保高専
12:00-13:00	昼 休 み					
13:00-13:20	総会(含「応用物理学会九州支部貢献賞」贈呈式)(A 会場)					
13:20-14:05	特別講演会「強誘電体薄膜の形成と不揮発メモリへの応用」 兼 支部オータムスクール「機能性薄膜とデバイス応用」I [As-1] (45 分)(1 件)					
14:05-14:15	休憩					
14:15-15:10	協賛企業講演(10 分)に引き続き (A 会場) 特別共通セミナー「表面洗浄と表面処理」I (45 分) (1 件)[Sc-1]					
15:10-15:20	休憩					
15:20-16:44 PM 前半 III (6 件)	特別共通セミナー「表面洗浄と表面処理」II (A 会場) (28 分×3 件) [Sc-2～Sc-4]			結晶工学 [p-1～p-6] 鈴木芳文 九工大工	プラズマ [p-1～p-6] 池上 知顕 熊大院自	超伝導 [p-1～p-7] 木須隆暢 九大シ情 (7 件)→16:58
16:44-16:54	休憩					
16:54-18:04 PM 後半 IV (5 件)	薄膜・表面 [p-1～p-5] 福山敦彦 宮崎大工	放射線 計測・制御 [p-1～p-5] 西岡賢祐 宮崎大工		結晶工学・ビーム [p-7～p-10] 鈴木芳文 九工大工 (4 件)→17:50	プラズマ [p-7～p-9] 池上 知顕 熊大院自 (3 件)→17:36	
18:30-20:00	懇 親 会 (生協食堂「エデュカ」)					

27 日(日)	A 会場	B 会場	C 会場	D 会場	E 会場	F 会場
10:00-11:24 AM 前半 V (6 件)	支部オータムスクール 「機能性薄膜とデバイス応用」II [As-2,As-3] (A 会場) (40 分×2 件)			有機・バイオ [a-1～a-6] 原 一広 九大工	光・光・量子エレ [a-1～a-6] 林 健司 九大シ情	応用物理一般 [a-1～a-6] 栗焼久夫 九大シ情
11:24-11:36	休憩					
11:36-13:00 AM 後半 VI (6 件)	薄膜・表面 [a-1～a-6] 古曳重美 九工大工	半導体 B [a-1～a-6] 吉武 剛 九大総理工	半導体 A [a-1～a-6] 池田晃裕 九大シ情	有機・バイオ [a-7～a-12] 須田隆夫 鹿児島高専	光・光・量子エレ [a-7～a-8] 林 健司 九大シ情 (2 件)→12:04	応用物理一般 [a-7～a-11] 寺田 貢 福大理 (5 件)→12:46
13:00-14:00	昼 休 み					
14:00-15:10 PM 前半 VII (5 件)	薄膜・表面 [p-1～p-5] 古曳重美 九工大工	半導体 B [p-1～p-7] 高倉健一郎 熊本高専 (7 件)→15:38		有機・バイオ [p-1～p-5] 古川昌司 九工大情		

各セッションの見方: 分科名、講演番号下 3 桁、座長、座長の所属、(件数→終了時刻)

講演番号について: 例えば、26Ba-8 は 26 日 B 会場午前の 8 番目の講演という意味で、講演番号の前に△があるのは、発表奨励賞を申請した講演。